

2806120 Ohutkalvotekniikka

Tentti 14.05.2003

KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KÄYTTÖ KIELLETTY

1. Termisen höyrystyksen pinnoituslähteet (sources)
2. Mihin kaikkeen tarkoitukseen PVD-pinnoitusprosesseissa voidaan hyödyntää kaasun ionisoitumista eli hehkupurkausta (glow discharge)?
3. Seosten terminen höyrystäminen – mahd. ongelmat ja keinot ratkaista ne?
4. Magnetron-sputterointi verrattuna perinteiseen (diodi)sputterointiin.
5. PVD-kovapinnoitteet, niiden ominaisuudet ja teollinen käyttö.
6. CVD-pinnoituslaitteiston eri osat ja tarkoitus.